



サンレーアンモニア燃焼除害装置は、半導体製造装置や研究施設等から排出されるアンモニアを含む排ガスを燃焼除害する装置です。永年培った燃焼技術をベースに、低NO_x燃焼を実現し、アンモニアを分解します。窒素含有溶剤の処理にも適応できます。

[特長]

1.低NO_x燃焼、高効率で完全分解

低No_x燃焼で環境に優しく、燃焼炉は高温且つ十分な滞留時間でアンモニアを酸化及び還元分解します。

2.小容量～大容量処理可能

受注生産の為、お客様のご要求に対応します。
排ガス集中処理等の大容量処理にも対応します。

3.コスト

ユーティリティが簡素化されており、装置が安価で経済的です。直接燃焼処理方式を採用しており、完全燃焼の上、乾式処理のため、余分な設備の必要がありません。また、すべて機器が自動コントロールされているため、維持管理も容易で人件費が節約されます。



4.安全重視、取扱容易

自動機器監視装置を装備、信頼性の高い機器を使用し、安全を最優先にした設計です。
シンプルな燃焼機構で保守管理も簡単な省人型の処理装置です。

5.省エネルギー、省スペース

装置をパッケージ内に収納し、省スペース化。また、乾式処理のため付帯設備は不要です。
省エネルギーに配慮したコントロールシステムを採用しております。

[用途]

半導体デバイス研究・製造施設、その他

[仕様]

※下記は、半導体研究施設への納入事例の仕様です。

	事例①	事例②
処理ガス成分	NH ₃ +H ₂ +N ₂	NH ₃ +H ₂ +N ₂
最大処理ガス量	12.6 m ³ /h(N)	66.6 m ³ /h(N)
助燃ガス量 (助燃ガス:都市ガス13A)	2～6.5 m ³ /h(N) (Hi-Low-Off制御方式)	1.9～15.1 m ³ /h(N) (比例制御方式)
処理後排ガス中のNH ₃ 濃度	0ppm	0ppm
処理後排ガス中のNO _x 濃度	8ppm以下	28ppm以下
設置スペース	W2000×D1500 ×H2000 (mm)	W2500×D1500 ×H2100 (mm)